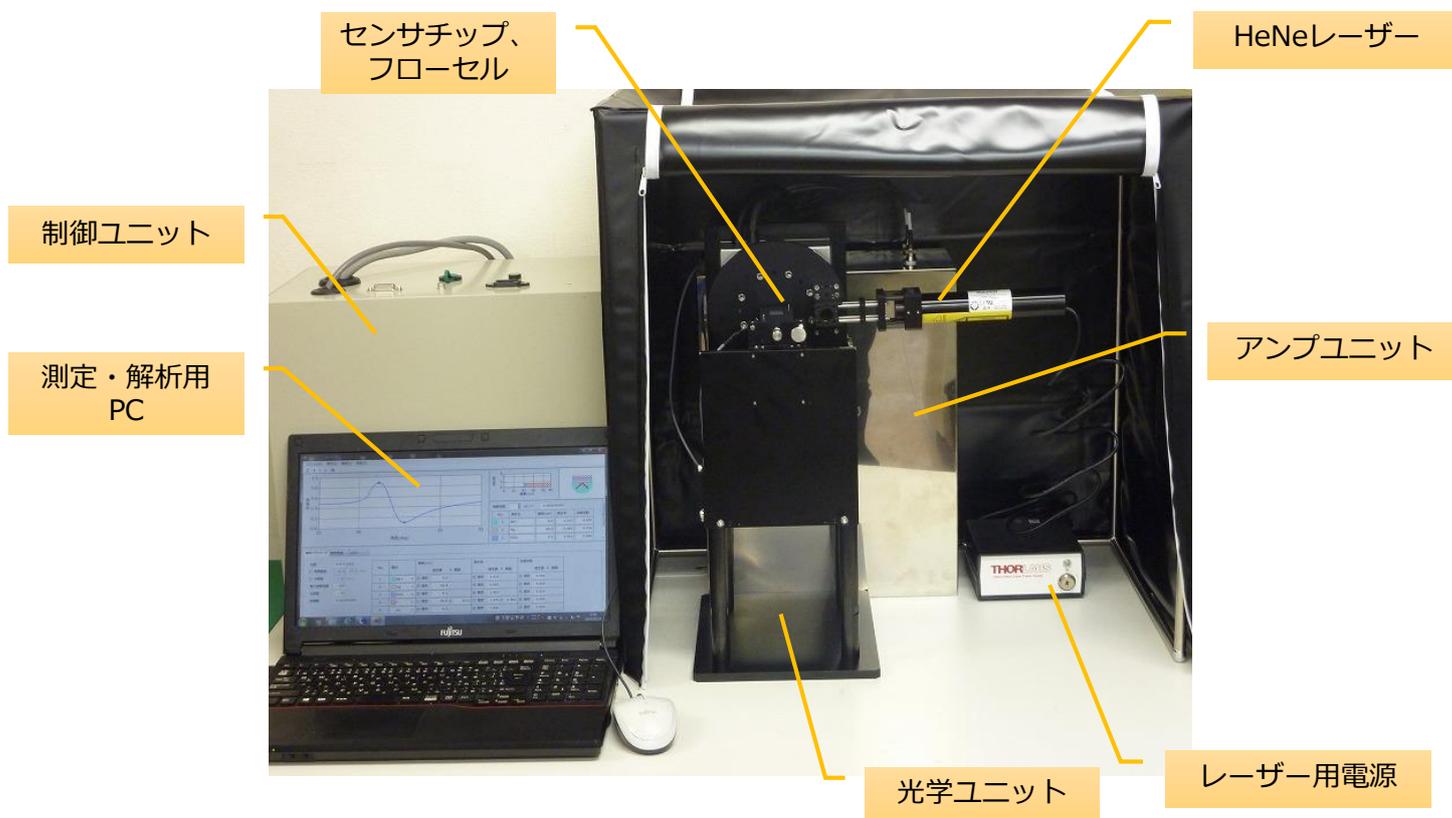


光学多重反射式膜厚測定装置 Thin Film Characterizer

小型・汎用タイプの高分子膜厚測定装置



➤ 機能

- **ワイドな測定レンジ**

1nmから100 μ mまでの幅広い測定レンジ。薄膜の膨潤過程の観察に！

- **環境制御が可能なフローセル**

試料の裏面から測定するため、試料表面の温度や雰囲気などの環境制御が可能！

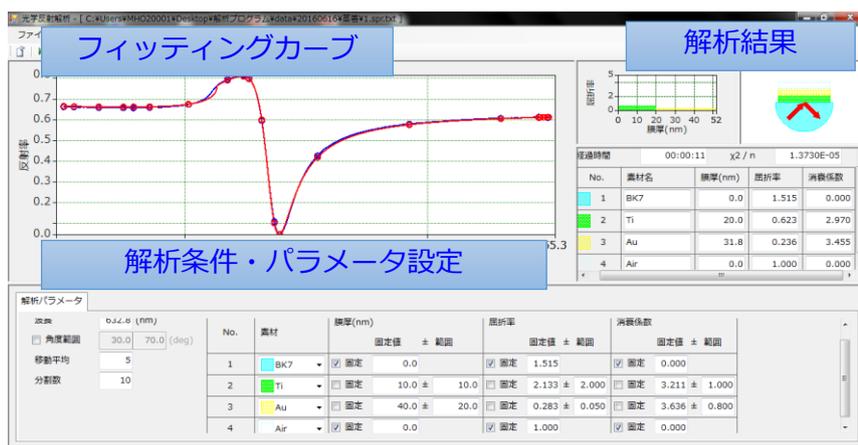
- **小型・低価格**

卓上サイズで省スペース。他の薄膜分析装置にはない低価格を実現！

仕様

項目	仕様
測定方式	光学多重反射率測定式
膜厚測定範囲	1 nm - 100 μ m
光源	He-Neレーザー 波長：632.8 nm 2 mW
サンプリング速度	1.25 MS / S
寸法	W 650 * D 650 * H 400 (システム全体)
重量	光学ユニット:7 kg / アンプユニット:3 kg / 制御ユニット:9 kg
電源	AC100 V MAX 1 A
センサチップ	寸法:15mm \times 15mm t:1.0mm / 材質:BK7

ソフトウェア



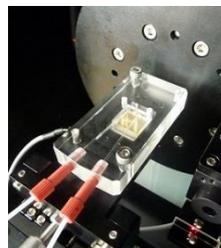
本分析システムにおいては、計測制御をおこなう「計測プログラム」と、測定データから薄膜試料の膜厚・屈折率・消衰係数を算出する「解析プログラム」があります。

「解析プログラム」では、実測したデータ波形に、シミュレーションによって得られる波形を近似させたときの条件から膜厚や屈折率を推定します。

アクセサリ



「加熱用フローセル」
アルミ製のフローセルで、薄型セラミックヒーターと制御用の温度センサを備えています。最大120℃までの加熱が可能です。



「簡易フローセル」
透明アクリル製のフローセルで、センサチップへの送液状態を簡単に確認することができます。標準では、1/8 inch チューブが接続可能なフィッティングを備えています。

※本装置はJST「先端計測分析技術・機器開発プログラム」の研究成果によるものです。

製造・開発

QK QUALITY & KINDNESS
九州計測器株式会社

本社：〒812-0015 福岡市博多区山王1丁目6-18
TEL：092-441-3200
FAX：092-441-3264
Web：http://www.qk-net.co.jp